

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ЭНЕРГИИ И ЗАХВАТА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ПРИ ФОТОИОНИЗАЦИИ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ В *p*-GaAs

Берегулин Е. В., Ярошевский И. Д.

Работа посвящена изучению процессов релаксации неравновесных носителей заряда в *p*-GaAs при азотной температуре, когда ИК излучение вызывает генерацию носителей с примесного центра.

Показано, что захват на примесный центр Zn идет с испусканием полярного оптического фонона. Определены времена внутризонной релаксации и захвата на примесь. Изучено нелинейное по интенсивности поведение фотопроводимости и линейного фотогальванического эффекта.

В предыдущих работах [¹⁻⁵] были выполнены исследования явлений, возникающих при поглощении излучения ИК лазеров свободными носителями в *p*-Ge.

Настоящая работа посвящена изучению процессов релаксации неравновесных носителей заряда в *p*-GaAs при азотной температуре, когда ИК излучение вызывает генерацию носителей с примесного центра.

Анализ модели релаксации и захвата

На рис. 1 приведена схема переходов в *p*-GaAs под действием излучения с энергией кванта $\hbar\nu=117$ мэВ. Валентная зона *p*-GaAs состоит из подзон легких V_1 и тяжелых дырок V_2 с эффективными массами соответственно $0.12 m_0$ и $0.5 m_0$ [⁶]. В используемых в эксперименте образцах величины энергии активации E_i и концентрации ионизованных примесей N_{A1} , определенные по методу Холла, оказались равными 17 мэВ и $4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. При азотной температуре дырки в основном находятся на примесном уровне.

Таким образом, под действием света дырки совершают переход с примесного уровня в валентную зону в состояние с энергией $E_k=100$ мэВ. Затем фотодырка релаксирует по энергии за счет испускания оптических фононов, пока не окажется в состоянии с энергией E_0 , меньшей энергии оптического фонона $E_{po}=36.7$ мэВ. При этом из-за высокой плотности состояний в тяжелой подзоне можно считать, что фотодырка находится в тяжелой подзоне и релаксация идет по ней. В процессе релаксации на втором этапе происходит установление функции распределения носителей заряда по энергии за счет взаимодействия с акустическими фононами, междузарядного взаимодействия и захвата на примесь. При используемых в эксперименте концентрациях носителей основным механизмом взаимодействия на этом этапе являются междузарядные столкновения.

Захват может идти разными путями, однако, как показано в работах [^{7, 8}], наиболее вероятным процессом в полярных полупроводниках при глубине залегания примеси порядка энергии оптического фонона является захват с испусканием полярного оптического фонона.

Получим функцию распределения $f(E)$, считая, что основным механизмом релаксации фотодырок по энергии при $E < E_{po}$ является релаксация за счет междузарядных столкновений, а захват и выброс с примесного уровня определя-

ются соответственно испусканием и поглощением полярного оптического фона.

Запишем кинетическое уравнение в диффузионном приближении в энергетическом пространстве

$$\frac{d}{dE} j(E) = -\alpha I(E-E_0) + \varrho(E) f(E) N_{A1} W(E, E') - N_{A0} N_q \delta(E) W(E, E'), \quad (1)$$

где E, E' — кинетическая энергия дырки до и после испускания оптического фонона, $j(E)$ — поток частиц в энергетическом пространстве, направленный в сторону меньших энергий, $\alpha = S_k N_{A0}$ — коэффициент поглощения, зависящий от интенсивности света, $\varrho(E)$ — зонная плотность состояний, N_{A1} — концентрация нейтральных акцепторов, N_q — функция распределения фононов, $W(E, E')$ — вероятность захвата со спонтанным испусканием оптического фонона в единицу времени.

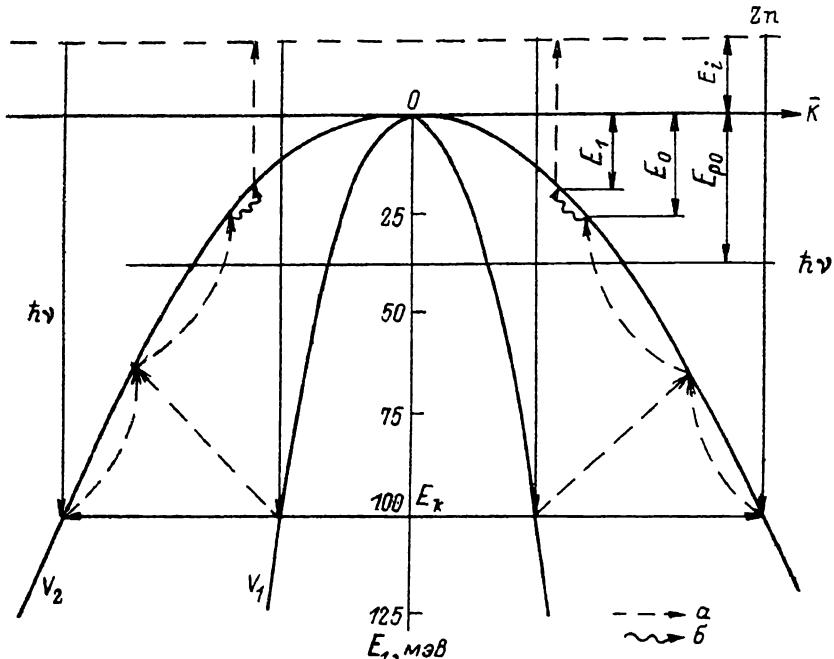


Рис. 1. Схема оптических переходов под действием света с энергией кванта $\hbar\nu=117$ мэВ и последующей релаксации в p -GaAs(Zn).

а — испускание полярных оптических фононов, б — междырочные столкновения.

щий от интенсивности света, S_k — сечение поглощения с примесного центра, $\varrho(E)$ — зонная плотность состояний, N_{A1} — концентрация нейтральных акцепторов, N_q — функция распределения фононов, $W(E, E')$ — вероятность захвата со спонтанным испусканием оптического фонона в единицу времени.

В работе [8] был выполнен квантово-механический расчет вероятности захвата носителей заряда с участием полярного оптического фонона:

$$W(E, E') = A \delta(E - E' - E_{po}), \quad (2)$$

$$A = \frac{10\pi^2 \hbar^3 e E_0 \beta}{V m^2 E_B}, \quad (3)$$

$$\beta = 2\pi \sqrt{E_B/E} [1 - \exp(-2\pi \sqrt{E_B/E})], \quad (4)$$

где

$$E_B = me^4 Z / (2\pi^2 \hbar^2) \quad (5)$$

— эффективная боровская энергия в кристалле для p -GaAs, равная при $Z=1$ $E_B=40.5$ мэВ, eE_0 — полярная оптическая константа, равная $1.35 \cdot 10^{-7}$ эрг/см.

В случае междырочных столкновений фотодырки с основной массой дырок с концентрацией p и эффективной температурой T_e поток имеет вид [3]

$$j(E) = B \left[f(E) + kT_e \frac{df}{dE} \right], \quad (6)$$

где $B = v_{pp}(E, p)$, $f(E) = 8pE_B\lambda/(\pi\hbar)$, $v_{pp}(E, p) = 2\sqrt{2}\pi pe^4\lambda/x^2 E^{3/2} m^{1/2}$ — частота междырочных столкновений. После подстановки выражений (6) и (2) в уравнение (5) оно приобретает вид

$$B \frac{d}{dE} \left[f(E) - kT_e \frac{df}{dE} \right] = -\alpha I \delta(E - E_0) + [f(E) \rho(E) N_{A1} - \rho(E) N_{A0} N_q] \delta(E - E_1). \quad (7)$$

При записи уравнения было учтено, что фотодырки после испускания оптических фононов приходят в состояние с энергией E_0 , а захват на примесный центр происходит из состояния с энергией E_1 , отстоящего от основного состояния примесного центра на энергию оптического фонона. Запись членов прихода и ухода в виде δ -функций возможна при условии, что пренебрегается шириной спектра возбуждающего света и взаимодействием при $E > E_p$ дырок друг с другом и с акустическими фононами.

Разбивая область интегрирования на 3 участка ($1 - E > E_1$, $2 - E_1 < E < E_0$, $3 - E > E_0$) и проводя интегрирование при условии, что $j(\infty) = 0$, получаем

$$f_1(E) = \frac{C(T_e, p_0)}{p} L(T_e) \left[\alpha I \tau_3(T_0, p_0) + \frac{p_0}{N'_{A0}} N_{A0} \right] \exp\left(-\frac{E}{kT_e}\right), \quad (8)$$

$$f_2(E) = f_1(E) + \frac{\alpha I}{B} \left\{ 1 - \exp\left[-\frac{(E - E_1)}{kT_e}\right] \right\}, \quad (9)$$

$$f_3(E) = f_1(E) + \frac{\alpha I}{B} \left\{ \exp\left[-\frac{(E - E_0)}{kT_e}\right] - \exp\left[-\frac{(E - E_1)}{kT_e}\right] \right\}, \quad (10)$$

где

$$\tau_3(T_0, p_0) = \left[\frac{j(T_0, p_0)}{p_0} \right]^{-1} = \frac{p_0}{C(T_0, p_0) N_{A1} \rho(E) \exp(E_1/kT_e)} \quad (11)$$

-- время захвата в равновесном случае,

$$L(T_e) = \left(\frac{T_e}{T_0} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_1}{kT_e} - \frac{E_1}{kT_0}\right), \quad (12)$$

$$C(T, p) = \frac{p}{2} \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT} \right)^{3/2} \quad (13)$$

Учитывая (8)–(10), можно получить зависимость концентрации носителей заряда в зоне от интенсивности света

$$p = N_{A0} S_k I \left[\tau_3(T_0, p_0) L(T_e) + \tau'_{pp} \left(\frac{p_0}{p} \right) \left(\frac{T_e}{T_0} \right)^{3/2} + \frac{N_{A0}}{N_A} p L(T_e) \right], \quad (14)$$

где

$$\tau'_{pp} = \frac{1}{v_{pp} E_0 p_0} \left\{ \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{E_1}{E_0} \right)^{3/2} \right] + \frac{kT_0}{E_0} \left[1 - \left(\frac{E_1}{E_0} \right)^{1/2} \right] \right\} \quad (15)$$

— время, в течение которого дырка релаксирует от E_0 до E_1 за счет междырочных столкновений.

Решая уравнение относительно p , получаем

$$p = \frac{N_{A0}}{2} \left(\frac{I}{I_{s1}} + \frac{p_0}{m_0} \right) L(T_e) + \sqrt{\left(\frac{I}{I_{s1}} + \frac{p_0}{m_0} \right)^2 L(T_e)^2 + 4 \frac{p_0}{m_0} \left(\frac{T_e}{T_0} \right)^{3/2} \frac{I}{I_{s2}}}, \quad (16)$$

где

$$I_{s1} = [S_k \tau_3(T_0, p_0)]^{-1}, \quad (17)$$

$$I_{s2} = [S_k \tau'_{pp}(T_0, p_0)]^{-1}. \quad (18)$$

Эффективную температуру T_e можно найти из условия энергетического баланса в системе дырок. При поглощении света в дырочную плазму в единицу времени вносится энергия, равная

$$P_+ = N_{A0} S_k I E_{\text{эфф}} \quad (19)$$

В рассматриваемом случае эффективная энергия

$$E_{\text{эфф}} = \hbar\nu - 3E_{\text{po}}. \quad (20)$$

Для случая $\nu_{\text{опт}} \gg \nu_{pp}$ можно записать скорость ухода энергии из дырочной плазмы [3]

$$P_- = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{m p_0}{p^2} \frac{I S_k}{\nu_{pp}(T_0, p_0)} \left(\frac{T_0}{T_e} \right)^{3/2} \frac{p^2}{p_0} E_{\text{po}} \left[\exp \left(-\frac{E_{\text{po}}}{T_e} \right) - \exp \left(-\frac{E_{\text{po}}}{T_0} \right) \right]. \quad (21)$$

Приравнивая (19) и (20), можно получить

$$\frac{\sqrt{\pi}}{4} \frac{m p_0}{p^2} \frac{I S_k}{\nu_{pp}(T_0, p_0)} \frac{E_{\text{эфф}}}{E_{\text{po}}} = \left(\frac{T_0}{T_e} \right) \left[\exp \left(-\frac{E_{\text{po}}}{T_e} \right) - \exp \left(-\frac{E_{\text{po}}}{T_0} \right) \right]. \quad (22)$$

Уравнения (22), (16) и условие электронейтральности

$$N_{A0} = N_{A0}^0 + p_0 - p \quad (23)$$

образуют полную систему уравнений для определения параметров дырочной плазмы при заданной интенсивности света.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Изучение процессов релаксации и захвата путем исследования поведения коэффициента поглощения при фотоионизации примесного центра наталкивается на ряд трудностей, одной из которых является увеличение внутризонного поглощения по мере роста концентрации в зоне, что приводит к невозможности выделения коэффициента поглощения с примесного центра в зону.

Однако перераспределение носителей заряда между примесным уровнем и зоной под действием света может не только вызвать изменение коэффициента поглощения с примесного центра, но и привести к возникновению фотопроводимости или вызвать насыщение примесного фотогальванического эффекта. Поэтому непосредственно в эксперименте исследовалась относительная фотопроводимость (п. 1) и примесный фотогальванический эффект (п. 2). Из зависи-

Параметр	Образец		
	1	2	3
$N_A, \text{ см}^{-3}$	$4.2 \cdot 10^{17}$	$4.2 \cdot 10^{17}$	$4.2 \cdot 10^{17}$
$N_D, \text{ см}^{-3}$	$4.1 \cdot 10^{17}$	$4.0 \cdot 10^{17}$	$3.1 \cdot 10^{17}$
$p, \text{ см}^{-3}$ при 300 К	$5.1 \cdot 10^{15}$	$2.3 \cdot 10^{16}$	$7.4 \cdot 10^{16}$
$p, \text{ см}^{-3}$ при 78 К	$5.3 \cdot 10^{14}$	$4.0 \cdot 10^{15}$	$1.4 \cdot 10^{16}$
$N_{A0}, \text{ см}^{-3}$ при 78 К	$5.7 \cdot 10^{15}$	$2.6 \cdot 10^{16}$	$7.6 \cdot 10^{16}$
Фотопроводимость			
$I_{s1}, \text{ МВт/см}^2$?	75 ± 20	75 ± 20
$I_{s2}, \text{ МВт/см}^2$	15	65 ± 15	$75 \div 150$
$\tau_3, \text{ пс}$?	0.35 ± 0.1	0.35 ± 0.1
$\tau_{pp}, \text{ пс}$	3.5	0.80 ± 0.2	$0.7 \div 0.35$
Фотогальванический эффект			
$I_{s1}, \text{ МВт/см}^2$?	75 ± 20	75 ± 20
$I_{s2}, \text{ МВт/см}^2$	6.5	52 ± 10	$75 \div 240$
$\tau_3, \text{ пс}$?	0.35 ± 0.1	0.35 ± 0.1
$\tau_{pp}, \text{ пс}$	8	1 ± 0.2	$0.7 \div 0.2$
$\tau_3, \text{ пс}$ [теория (11)]	0.35	0.35	0.35
$\tau_{pp}, \text{ пс}$ [теория (15)]	6	0.80	0.25

мости этих эффектов от интенсивности света была получена информация о процессах релаксации энергии и захвата носителей в *p*-GaAs. Заметим, что исследование этих эффектов интересно и само по себе как изучение поведения фотопроводимости при большой интенсивности света вплоть до интенсивностей, при которых происходит разрушение материала.

Измерения были выполнены в образцах *p*-GaAs, легированных Zn при 78 К и облучении их светом CO₂-лазера с длиной волны 10.6 мкм. Параметры образцов приведены в таблице.

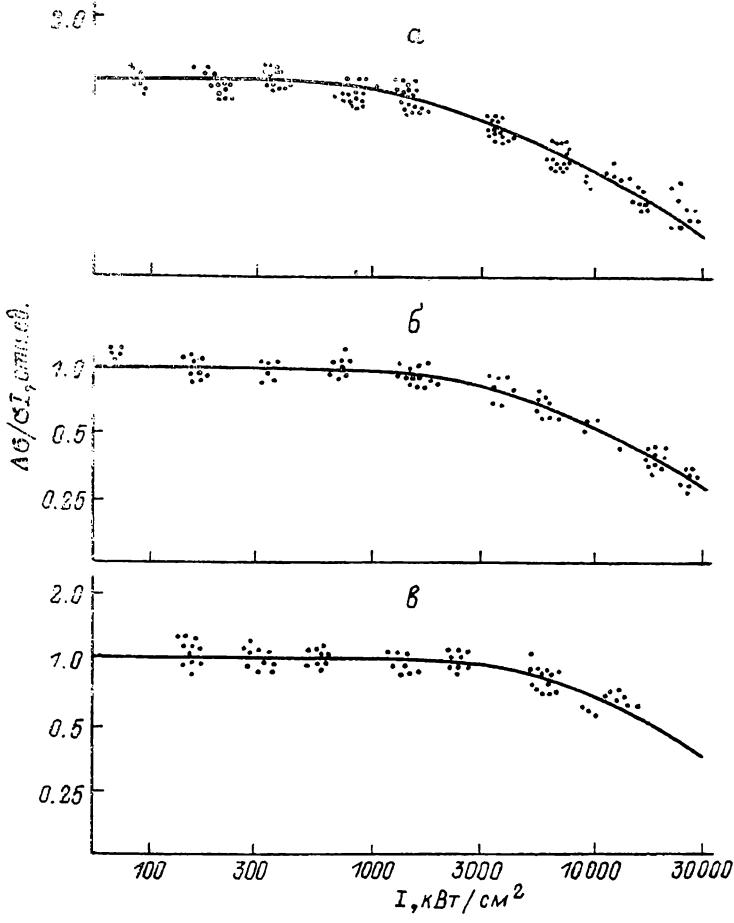


Рис. 2. Зависимость нормированной фотопроводимости от интенсивности света.

Точки — эксперимент, кривые — теория. Образцы: а — 1, б — 2, в — 3.

1. Относительная фотопроводимость, зависящая от интенсивности света, может быть представлена в виде

$$\frac{\Delta\sigma(I)}{\sigma} = \frac{\sigma(I) - \sigma(0)}{\sigma(0)} = \frac{\mu(I)p(I)}{\mu(0)p_0} - 1, \quad (24)$$

где $\mu(I)$ и $\sigma(I)$ — подвижность и проводимость материала при световом возбуждении.

Зависимость фотопроводимости от интенсивности света обусловлена изменением как концентрации в зоне, так и подвижности из-за изменения эффективной температуры дырок. Подвижность в *p*-GaAs в диапазоне температур 78–300 К, согласно работе [9], определяется совместным действием рассеяния носителей тока на ионизированных примесях и на акустических фононах.

На рис. 2 приведена зависимость $\Delta\sigma(I)/\sigma(0)I$ от интенсивности света. Теоретические кривые построены в соответствии с (24) при учете (16) с I_{s1}

и I_{s2} , взятыми в качестве подгоночных параметров. В эксперименте отчетливо наблюдается насыщение примесной фотопроводимости, обусловленное уменьшением коэффициента поглощения с примесного уровня и изменением суммарного времени релаксации, слагающегося из времени внутризонной релаксации и времени захвата на примесный уровень. Зависимость времени релаксации по энергии от интенсивности света, имеющая место в рассматриваемом случае, обусловлена, как отмечалось выше, изменением концентрации носителей заряда и температуры дырок в зоне. Полученные параметры насыщения приведены в таблице. Там же представлены времена внутризонной релаксации и захвата на примесь, полученные из I_{s1} и I_{s2} .

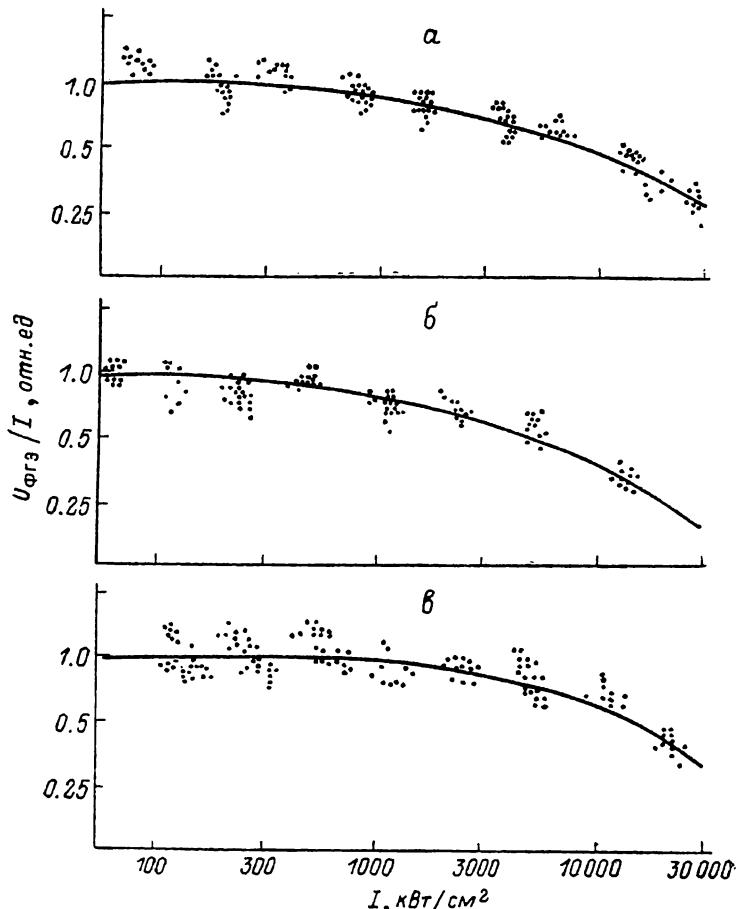


Рис. 3. Зависимость нормированной ЭДС фотогальванического эффекта от интенсивности света.

Точки — эксперимент, кривые — теория. Образцы: а — 1, б — 2, в — 3.

2. Подробно фотогальванический эффект (ФГЭ) в p -GaAs(Zn), заключающийся в возникновении постоянного электрического тока в однородном кристалле под действием однородного освещения, исследовался в работе [10]. Была обнаружена температурная и концентрационная инверсия знака ФГЭ и показано, что при 300 К эффект связан с оптическими переходами внутри валентной зоны, а при 78 К обусловлен асимметрией фотовозбуждения носителей заряда с примесного центра.

ЭДС ФГЭ, зависящую от интенсивности света, в нашем случае можно выразить следующим образом:

$$V_{\text{ФГЭ}}(I) \sim \frac{\alpha(I) I}{\sigma(I)} \sim \frac{N_{A0}(I) I}{\mu(I) p(I)}. \quad (25)$$

Вопрос о поведении N_{A0} , p , μ обсуждался ранее. В экспериментах использовались те же образцы, что и при исследованиях фотопроводимости. Ориентация образцов выбиралась такой, чтобы наблюдалась только ЭДС ФГЭ, а именно свет распространялся по направлению [110], ЭДС регистрировалась вдоль [110], а плоскость поляризации устанавливалась под углом 45° к направлению [110].

На рис. 3 приведена зависимость нормированной ЭДС ФГЭ от интенсивности света. Наблюдаемая зависимость обусловлена как уменьшением коэффициента поглощения с примесного центра, так и увеличением проводимости образца за счет генерации носителей и изменения подвижности. На экспериментальные точки были наложены соответствующие теоретические зависимости, полученные в соответствии с (25) при учете (16) с I_{s1} и I_{s2} , взятыми в качестве регулируемых параметров. Полученные величины параметров, а также времена релаксации и захвата приведены в таблице.

Как видно из таблицы, величины времен релаксации и захвата, полученные при исследовании ФГЭ, оказались близкими к аналогичным величинам, полученным из анализа нелинейного поведения примесной фотопроводимости. При этом время внутризонной релаксации энергии τ'_{pp} практически линейно связано с концентрацией носителей заряда p , а время захвата τ_s не зависит от нее.

Для образца 1 полное время релаксации фотовозбужденных дырок по энергии определяется темпом внутризонной релаксации энергии, поэтому экспериментально время захвата установить не удалось. При увеличении концентрации носителей заряда время τ'_{pp} падает и для образца 3 оно сравнивается с временем захвата.

Малая величина времени захвата (~ 0.35 пс) обусловлена двумя факторами: большой концентрацией захватывающих центров и большим сечением захвата на примесный центр Zn. До настоящего времени это сечение не было экспериментально определено. Согласно теоретической работе [8], высокое сечение захвата в p -GaAs может быть объяснено тем, что захват идет резонансно с испусканием полярного оптического фонона. Теоретическая величина сечения захвата равна 10^{-12} см 2 . В описанных опытах была получена величина, близкая к теоретической.

Таким образом, из опытов по исследованию фотопроводимости и фотогальванического эффекта при большой интенсивности света можно сделать вывод, что в соответствии с проделанным выше анализом захват на примесный центр Zn в p -GaAs действительно идет с испусканием полярного оптического фонона. При этом в образцах с $N_A - N_D < 2 \cdot 10^{16}$ см $^{-3}$ при азотной температуре полное время релаксации фотовозбужденных дырок в основном определяется внутризонной релаксацией, а сам захват на примесь происходит быстро.

В заключение авторы благодарят В. Н. Абакумова и И. Н. Яссиевич за полезное обсуждение работы.

Список литературы

- [1] Берегулин Е. В., Валов П. М., Ярошецкий И. Д. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 1. С. 109–116.
- [2] Берегулин Е. В., Валов П. М., Ярошецкий И. Д. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 2. С. 239–244.
- [3] Яссиевич И. Н., Ярошецкий И. Д. // ФТП. 1975. Т. 9. В. 5. С. 857–866.
- [4] Комолов В. Л., Ярошецкий И. Д., Яссиевич И. Н. // ФТП. 1977. Т. 11. В. 1. С. 85–93.
- [5] Берегулин Е. В., Ганичев С. Д., Ярошецкий И. Д., Яссиевич И. Н. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 2. С. 286–290.
- [6] Баранский П. И., Ключков В. П., Потыкевич И. В. Полупроводниковая электроника. М., 1975. 703 с.
- [7] Абакумов В. Н., Соколова З. Н. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 8. С. 1625–1628.
- [8] Абакумов В. Н., Соколова З. Н. // Изв. ЛЭТИ. Т. 247. Л., 1980.
- [9] Гасанли Ш. М. и др. // ФТП. 1971. Т. 5. В. 10. С. 1888–1892.
- [10] Андрианов А. В., Валов П. М., Ярошецкий И. Д. // Письма ЖЭТФ. 1980. Т. 31. В. 6. С. 533–535.